



(43) 国際公開日
2001 年 4 月 26 日 (26.04.2001)

PCT

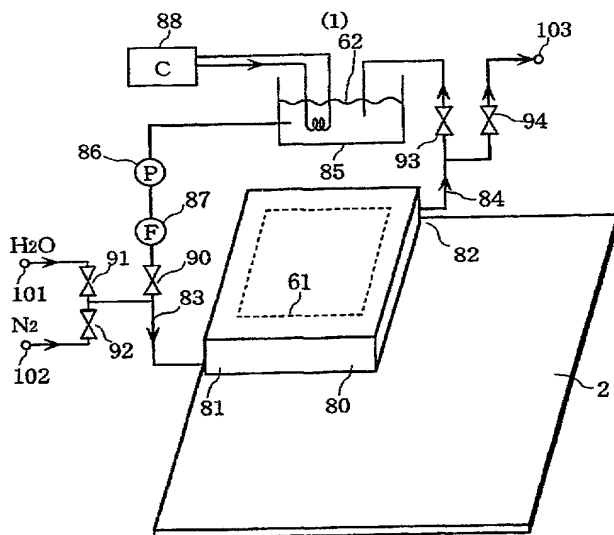
(10) 国際公開番号
WO 01/29807 A1

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| (51) 国際特許分類 ⁷⁾ : | G09F 9/00, G02F 1/136 | (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP). |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP00/07250 | |
| (22) 国際出願日: | 2000年10月18日 (18.10.2000) | (72) 発明者; および |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川崎清弘 (KAWASAKI, Kiyohiro) [JP/JP]; 〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木1-8-3 Osaka (JP). |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | |
| (30) 優先権データ:
特願平 11/299655 | 1999年10月21日 (21.10.1999) JP | (74) 代理人: 大前 要 (OHMAE, Kaname); 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-3-14 ライオンズビル大手前2階 Osaka (JP). |
| 特願平 2000-107577 | 2000年4月10日 (10.04.2000) JP | (81) 指定国 (国内): KR, US. |

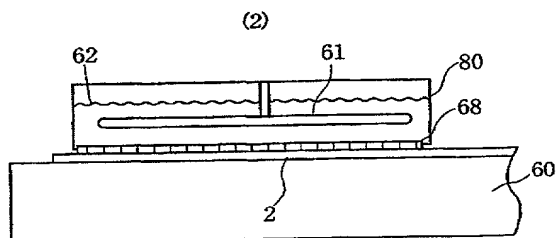
[続葉有]

(54) Title: INSPECTION AND REPAIR OF ACTIVE SUBSTRATE

(54) 発明の名称: アクティブ基板の検査と修復



(57) Abstract: Pin holes in an insulation layer on a conductive pattern are identified and repaired by a simple means and device using the following methods, with a trend seen that the substrates of liquid crystal display devices are increasing in size. 1. A chemical is allowed to stay and held in a particular area on a substrate, and an electrode plate is allowed to contact or approach the chemical to permit an electric treatment by a sheet and a pin hole inspection. Four types of chemical holding mechanisms are available. 2. The chemical is treated in a measure-like container to prevent the occurrence of chemical mist. 3. An insulating element formed by anodic oxidation or the like is used to bury an insulating layer on a conductive pattern. 4. Scanning lines (and common capacity lines and/or counter electrodes) in a pin hole are inactivated by electrochemical treating.



[統葉有]

WO 01/29807 A1